

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 3 部門第 4 区分

【発行日】平成23年12月1日(2011.12.1)

【公開番号】特開2010-106327(P2010-106327A)

【公開日】平成22年5月13日(2010.5.13)

【年通号数】公開・登録公報2010-019

【出願番号】特願2008-280723(P2008-280723)

【国際特許分類】

C 2 3 C 28/04 (2006.01)

C 2 3 C 4/10 (2006.01)

C 2 3 C 18/12 (2006.01)

H 0 1 L 21/3065 (2006.01)

C 0 4 B 41/87 (2006.01)

C 0 4 B 41/89 (2006.01)

B 3 2 B 9/00 (2006.01)

【 F I 】

C 2 3 C 28/04

C 2 3 C 4/10

C 2 3 C 18/12

H 0 1 L 21/302 1 0 1 G

C 0 4 B 41/87 J

C 0 4 B 41/89 A

B 3 2 B 9/00 A

【手続補正書】

【提出日】平成23年10月18日(2011.10.18)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 3 1

【補正方法】変更

【補正の内容】

【 0 0 3 1 】

また、試料 3、4 では基材と酸化ガドリニウム溶射膜の間で剥離が発生した。したがって、酸化ガドリニウムゾルゲル膜を形成することにより、ハロゲン系腐食ガスおよびハロゲン系ガスプラズマを遮断し、基材からのパーティクル発生に対し軽減効果が得られることが分かった。